



(Taiwan)

EVG Launches New Multifunctional Micro/Nano Imprint Solution– January 20, 2022

EVG新推多功能微米/奈米壓印解決方案

發布日期：2022/01/21 關鍵字：[UV](#)、[晶圓](#)、[NIL](#)、[EVG](#)、[EV Group](#)

EV Group(EVG)推出EVG7300自動化SmartNIL奈米壓印與晶圓級光學系統。EVG7300是EVG最先進的解決方案，可在單一平台上結合如奈米壓印微影技術(NIL)、透鏡壓鑄與透鏡堆疊(UV接合)等多重基於UV架構的製程。

這套隨時可供業界使用的多功能系統，旨在滿足涉及各種微型和奈米圖案以及功能層堆疊等嶄新應用的先進研發與生產需求，包括晶圓級光學(WLO)、光學感測器與投影機、汽車照明、擴增實境頭戴式裝置使用的波導管、生物醫療設備、超穎透鏡(Meta-Lens)與超穎介面(Meta-Surface)，以及光電學。EVG7300支援大至300毫米的晶圓尺寸，並具備精度對準功能、先進製程控制與高製程產出量，滿足各種自由形式及高精度奈米和微型光學元件與設備的量產需求。

EVG7300既可作為獨立工具，也可當作一個模組整合在EVG的HERCULES® NIL之中，作為UV-奈米壓印微影(UV-NIL)的全整合解決方案，其中還可增加如清洗、光阻塗層，以及烘烤或後處理等額外的預處理步驟，以最佳化特定製程的需求。這套系統透過結合對準階段的改善、高精度光學元件、多點間隙控制、非接觸式間隙量測與多點力控制，具領先業界最高可達300奈米的對準精度。

EVG7300是具高度彈性的平台，提供三種不同的製程模式，包含透鏡壓鑄、透鏡堆疊與SmartNIL奈米壓印，並支援150毫米到300毫米晶圓的基板尺寸。模板與晶圓的快速裝載、快速對準的光學元件、高功率固化以及極小的工具佔用空間，使這套高效平台能夠滿足業界對嶄新WLO產品的製造需求。

<https://www.mem.com.tw/arti.php?sn=2201200003>